## Влияние магнитного поля в плоскости пленки феррита-граната с ромбической магнитной анизотропией на динамику доменных стенок

© В.В. Рандошкин, В.А. Полежаев, Н.Н. Сысоев, Ю.Н. Сажин\*, В.Н. Дудоров\*

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119899 Москва, Россия \* Совместная хозрасчетная лаборатория "Магнитооптоэлектроника" Института общей физики Российской академии наук при Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева, 430000 Саранск, Россия

## (Поступила в Редакцию 7 февраля 2002 г. В окончательной редакции 19 июня 2002 г.)

Определено влияние планарного магнитного поля на зависимость скорости доменных стенок (ДС) от действующего магнитного поля в висмутсодержащих монокристаллических пленках ферритов-гранатов состава (Bi,Y,Pr)<sub>3</sub>(Fe,Ga)<sub>5</sub>O<sub>12</sub> с ориентацией (210). Планарное магнитное поле прикладывалось вдоль кристаллографических осей (120) и (001). Измерялась скорость ДС, движущихся перпендикулярно и параллельно направлению планарного магнитного поля.

В висмутсодержащих монокристаллических пленках ферритов-гранатов  $(Bc-M\Pi\Phi\Gamma)$ состава (Bi,Y,Pr)<sub>3</sub>(Fe,Ga)<sub>5</sub>O<sub>12</sub> с ориентацией (210), обладающих ромбической магнитной анизотропией (РМА), скорость доменных стенок (ДС) V превышает 1 km/s [1-6]. При этом зависимости V от действующего магнитного поля Н в пленках близкого химического состава существенно различаются [2-4]. В Вс-МПФГ с однонаправленной анизотропией скорости ДС как форма динамических доменов, так и значение V сильно зависят от планарного магнитного поля  $H_{in}$ .

В некоторых Вс-МПФГ состава (Bi,Y,Pr)<sub>3</sub>(Fe,Ga)<sub>5</sub>O<sub>12</sub> с ориентацией (210) зависимость скорости ДС от действующего магнитного поля на первый взгляд имеет классический вид: на кривой V(H) после начального линейного участка наблюдается небольшой пик, за которым следует участок насыщения, характеризующийся дифференциальной подвижностью ДС, много меньшей начальной [1-5]. Однако наблюдение с помощью метода высокоскоростной фотографии (ВСФ) динамических доменов в полях, примерно соответствующих середине этого "линейного" участка, показало, что их ДС испытывает нерегулярные искажения, не повторяющиеся от импульса к импульсу [5,6]. Следовательно, линейному участку кривой V(H) соответствует нестационарное движение ДС, что противоречит теории [7]. Более детальные исследования показали [8], что появление пространственных искажений ДС в Вс-МПФГ с РМА соответствует переходу ко второму линейному участку с несколько повышенной дифференциальной подвижностью, появление которого связано с излучением спиновых волн, инициирующих локальное вращение намагниченности вблизи движущейся ДС [9].

Целью настоящей работы являлось исследование влияния планарного магнитного поля на Вс-МПФГ состава (Bi,Y,Pr)<sub>3</sub>(Fe,Ga)<sub>5</sub>O<sub>12</sub> с ориентацией (210) и классическим видом кривой V(H). Исследования проводились на установке ВСФ [10] с помощью метода перемагничивания [11]. О величине РМА судили по максимальному  $H_{\rm max}$  и минимальному  $H_{\rm min}$  значениям планарного магнитного поля, при которых исчезает доменная структура [9].

При исследовании динамики ДС в исходном состоянии Вс-МПФГ намагничивалась до насыщения полем смещения  $H_b = 43$  Ое, приложенным вдоль нормали к ее плоскости. Импульсное магнитное поле  $H_p$  прикладывалось в противоположном направлении с помощью пары плоских катушек, в центре между которыми располагалась исследуемая пленка. Регистрировалось изображение домена с обратной намагниченностью (ДОН), зарождающегося на точечном дефекте. Заметим, что при некоторых комбинациях магнитных полей ДОН не удавалось получить.

В настоящей работе приводятся данные для образца с толщиной  $h = 7.3 \,\mu$ m, равновесной шириной полосовых доменов  $w = 16.3 \,\mu$ m, поле коллапса цилиндрических магнитных доменов  $H_0 = 20.0$  Oe,  $H_{\text{min}} = 2000$  Oe,  $H_{\text{max}} = 4800$  Oe.

Действующее магнитное поле определяли так же, как в работе [11],

$$H = H_p - H_b,$$

т.е. без учета наклона оси легкого намагничивания. Изза этого первый участок кривой V(H) в ряде случаев пересекает ось абсцисс при отрицательных значениях H. Планарное магнитное поле прикладывалось вдоль направлений  $\langle 120 \rangle$  и  $\langle 001 \rangle$  в плоскости пленки. Заметим, что первому из указанных направлений соответствует минимальное значение планарного магнитного поля, при котором исчезает доменная структура, второму — максимальное. Измерялась скорость ДС, движущихся перпендикулярно и параллельно направлению планарного магнитного поля.

№ п/п	Номер рисунка	$H_{\rm in}=134{\rm Oe}$			$H_{\rm in}=268{ m Oe}$			$H_{\rm in}=402{ m Oe}$		
		$\mu$ , m/(s·Oe)	$V_p$ , m/s	V <sub>max</sub> , m/s	$\mu$ , m/(s·Oe)	$V_p$ , m/s	V <sub>max</sub> , m/s	$\mu$ , m/(s·Oe)	$V_p,$ m/s	V <sub>max</sub> , m/s
1	2, a	12.1	2120	2200	13.5	1250	1440	8.7	1080	1620
2	2, b	7.4		1870	7.6		1600	5.2		1310
3	2, c	6.4	1400	1400	7.0	1710	1710			1140
4	3, <i>a</i>	7.1	1100	2050	5.8	1440	2820	8.5	1330	1330
5	3, <i>b</i>	10.9	830	1620	6.5	1010	1600	6.5	700	1330
6	4, <i>a</i>	14.3	980	1700			1340			1370
7	4, <i>b</i>	4.5	1150	1570			1270			1350
8	5, <i>a</i>	8.6	1010	1270	8.0	1170	1550	7.1	1130	1360
9	5, b	12.5	1080	1650	11.1	930	1510	9.0	970	1850
10	6, <i>a</i>			1700			1450			1760
11	6, <i>b</i>	6.6	1150	1350	6.6	1260	1310	6.1	860	1310

Динамические параметры Вс-МПФГ

Результаты измерений приведены на рис. 1-6 и в таблице. Измерения проводились при трех фиксированных значениях H<sub>in</sub>. В верхней части рис. 2-6 показана геометрия эксперимента (взаимная ориетация кристаллографического направления (120), вектора планарного магнитного поля и вектора скорости ДС). Значение V при каждом Н определялось как результат усреднения по пяти измерениям. Вертикальными отрезками показан разброс результатов измерений. Эти отрезки для наглядности соединены линиями. Заметим, что разброс связан не с низкой точностью измерений, достигающей 3% [11], а с искажениями формы динамических доменов [5], которые не повторяются от импульса к импульсу. При наличии на кривой V(H) достаточно протяженного начального линейного участка определялись его наклон (подвижность ДС  $\mu$ ) и значение скорости ДС  $V_p$ , при котором этот участок заканчивается. Эти величины, а также значение максимальной скорости ДС V<sub>max</sub>, измеренной в эксперименте, приведены в таблице.

На рис. 1 приведена зависимость V(H) для случая, когда планарное магнитное поле не прикладывалось. Видно, что наклон начального участка этой кривой составляет 8.6 m/(s·Oe) и он заканчивается, когда скорость ДС достигает значения  $V_p = 1730$  m/s. Максимальная скорость ДС, измеренная в этом эксперименте, составляет  $V_{\text{max}} = 2170$  m/s.

На рис. 2, *а* приведены зависимости V(H) для случая, когда планарное магнитное поле приложено вдоль оси  $\langle 120 \rangle$ , а измеряется скорость ДС, движущейся в том же направлении. Сравнение рис. 1 и 2, *а* показывает, что приложение поля  $H_{\rm in} = 134$  Ое вдоль направления, соответствующего минимуму поля исчезновения доменной структуры  $H_{\rm min}$ , приводит к росту наклона начального участка кривой V(H) до 12.1 m/(s·Oe), значение  $V_p$  увеличивается до 2120 m/s, а  $V_{\rm max}$  практически не меняется (см. таблицу). Дальнейшее повышение  $H_{\rm in}$  приводит к снижению значений  $V_p$  и  $V_{\rm max}$ , при этом диапазон изменения действующего магнитного поля, в котором существует ДС, сужается по мере роста  $H_{\rm in}$ .

Заметим, что при  $H_{\rm in} = 268$  Ое подвижность ДС имеет максимальное значение во всей серии экспериментов (см. таблицу). Кроме того, из рис. 2, *a* (кривая 2) видно, что для зависимости V(H) наблюдается не один, как на рис. 1 и 2, *a* (кривая *I*), а два локальных минимума.

На рис. 2, *b*, *c* приведены зависимости V(H) для случаев, когда направление планарного магнитного поля изменено на противоположное, а измеряется скоростью ДС, движущихся вдоль направления планарного поля в разные стороны. Узкий пик на кривой *1* (рис. 2, *b*), по-видимому, обусловлен наличием однонаправленной анизотропии скорости ДС. Из сравнения рис. 1 и 2, *b*, *c* 



**Рис. 1.** Зависимость скорости *V* ДС от действующего магнитного поля *H* при отсутствии планарного магнитного поля.



**Рис. 2.** Зависимость скорости V ДС, движущихся вдоль направления планарного магнитного поля  $H_{in}$ , которое приложено вдоль кристаллографической оси (120), от действующего магнитного поля H при разных значениях  $H_{in}$ .  $H_{in}$ , Oe: 1 - 134, 2 - 268, 3 - 402. Здесь и далее в верхней части рисунков показана геометрия эксперимента.

видно, что приложение планарного поля  $H_{\rm in} = 402$  Ое практически вдвое сужает диапазон изменения поля H, в котором зарождается ДОН.



**Рис. 3.** Зависимость скорости V ДС, движущихся перпендикулярно направлению планарного магнитного поля  $H_{\rm in}$ , которое приложено вдоль кристаллографической оси (120), от действующего магнитного поля H при разных значениях  $H_{\rm in}$ .  $H_{\rm in}$ , Oe: 1 - 134, 2 - 268, 3 - 402.

На рис. 3, *а*, *b* приведены зависимости V(H) для случаев, когда измеряется скорость ДС, движущихся перпендикулярно направлению планарного поля, а поле  $H_{in}$  попрежнему приложено вдоль направления (120). Видно, что для обоих направлений планарного магнитного поля на кривых V(H) наблюдаются два локальных минимума (кривая 2 на рис. 3, *a*; кривая 1 на рис. 3, *b*). Для геометрии эксперимента, показанной на рис. 3, *a*, достигается максимальная скорость ДС (см. таблицу), составляющая  $V_{\text{max}} = 2820 \text{ m/s}$ . При  $H_{\text{in}} = 402 \text{ Oe}$  (кривые 3 на рис. 3, *a*, *b*) диапазон изменения поля *H*, в котором зарождаются ДОН, существенно у́же, чем при меньших значениях  $H_{\text{in}}$  (кривые 1 и 2 на рис. 3, *a*, *b*).

На рис. 4 приведены зависимости V(H) для случая, когда поле  $H_{\rm in}$  приложено перпендикулярно кристаллографическому направлению (120) (по оси (001)). Измерялась скорость ДС, движущихся в обе стороны вдоль этой оси. При такой геометрии эксперимента значение планарного магнитного поля, при котором исчезает доменная структура, максимально. Для обоих направлений движения ДС на кривой V(H) наблюдаются два локальных минимума (кривые 1 на рис. 4, *a*, *b*). Прило-



**Рис. 4.** Зависимость скорости V ДС, движущихся вдоль направления планарного магнитного поля  $H_{in}$ , которое приложено перпендикулярно кристаллографической оси (120) (по направлению (001)), от действующего магнитного поля H при разных значениях  $H_{in}$ .  $H_{in}$ , Oe: 1 - 134, 2 - 268, 3 - 402.



**Рис. 5.** Зависимость скорости V ДС, движущихся вдоль направления планарного магнитного поля  $H_{in}$ , которое приложено перпендикулярно кристаллографической оси (120) (противоположно (001)), от действующего магнитного поля H при разных значениях  $H_{in}$ .  $H_{in}$ , Oe: 1 - 134, 2 - 268, 3 - 402.



**Рис. 6.** Зависимость скорости V ДС, движущихся перпендикулярно направлению планарного магнитного поля  $H_{in}$ , которое приложено перпендикулярно кристаллографической оси (120) (вдоль (001)), от действующего магнитного поля H при разных значениях  $H_{in}$ .  $H_{in}$ , Oe: 1 - 134, 2 - 268, 3 - 402.

жение достаточно сильного планарного магнитного поля приводит к тому, что в некотором диапазоне изменения действующего магнитного поля, примыкающем к оси ординат, ДОН перестают зарождаться (кривые 2 и 3 на рис. 4, a, b). Этот диапазон тем шире, чем выше  $H_{\rm in}$ .

Если направление планарного магнитного поля изменить на противоположное (по сравнению со случаем, приведенным на рис. 4), то оно перестает сколько-нибудь существенно влиять на зарождение ДОН (рис. 5, *a*, *b*). При этом ширина диапазона изменения  $H_p$ , в котором происходит зарождение ДОН, почти такая же, как и при  $H_{in} = 0$  (рис. 1). На зависимости V(H) (кривая *I* на рис. 5, *b*) также наблюдаются два локальных минимума.

На рис. 6 приведены зависимости V(H) для случая, когда поле  $H_{in}$  приложено перпендикулярно кристаллографическому направлению (120) (по оси (001)). Измерялась скорость ДС, движущихся вдоль оси  $\langle 120 \rangle$ . Видно, что и при этой геометрии эксперимента кривые V(H)имеют локальные минимумы (например, кривая I на рис. 6, a), хотя они менее ярко выражены.

Таким образом, в настоящей работе показано, что для Вс-МПФГ состава  $(Bi,Y,Pr)_3(Fe,Ga)_5O_{12}$  с ориентацией (210) характерно следующее.

1) Приложение планарного магнитного поля вдоль кристаллографической оси (001) препятствует зарождению ДОН при импульсном перемагничивании пленки.

2) Максималная скоростью ДС достигается, если планарное магнитное поле приложено вдоль кристаллографической оси (120), а ДС движется вдоль кристаллографической оси (001).

3) Максимальная подвижность ДС достигается, если планарное магнитное поле приложено вдоль кристаллографической оси (001), а ДС движется вдоль кристаллографической оси (120).

4) При определенных направлениях и значениях планарного магнитного поля на зависимости скорости ДС от действующего магнитного поля наблюдаются два локальных минимума.

## Список литературы

- В.В. Рандошкин, В.И. Чани, М.В. Логунов, Ю.Н. Сажин, В.П. Клин, Б.П. Нам, А.Г. Соловьев, А.Я. Червоненкис. Письма в ЖТФ 15, 14, 42 (1989).
- [2] V.V. Randoshkin. In: Thin Films and Beam-Solid Interaction / Ed. L. Huang. Elsevier Science Publishers B.V. (1990). Vol. 4. P. 267.
- [3] В.В. Рандошкин. Тр. ИОФАН 35, 49 (1992).
- [4] В.В. Рандошкин, М.В. Логунов, Ю.Н. Сажин. ФТТ 32, 5, 1456 (1990).
- [5] В.В. Рандошкин, М.В. Логунов, Ю.Н. Сажин. ЖТФ 66, 2, 201 (1996).
- [6] В.В. Рандошкин, М.В. Логунов, Ю.Н. Сажин. Новые магнитные материалы микроэлектроники. Тез. докл. XIV Всерос. школы-семинара. М. (1994). Ч. 2. С. 32.
- [7] А. Малоземов, Дж. Слонзуски. Доменные стенки в материалах с цилиндрическими магнитными доменами. Пер. с англ. Мир, М. (1982). 382 с.
- [8] В.В. Рандошкин, Ю.Н. Сажин. ФТТ, в печати.
- [9] В.В. Рандошкин, Ю.Н. Сажин. ЖТФ 66, 8, 83 (1996).
- [10] В.В. Рандошкин, М.В. Логунов, В.Б. Сигачев. ПТЭ 5, 247 (1985).
- [11] В.В. Рандошкин. ПТЭ 2, 155 (1995).